

УДК 537.226.4

© 1990

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТОЧЕЧНЫХ ДЕФЕКТОВ  
С ДОМЕННЫМИ СТЕНКАМИ  
В ВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СЕГНЕТОЭЛЕКТРИКАХ**

*Л. Н. Камышева, О. М. Сердюк, С. Н. Дрождин, О. А. Зайцева*

Приводятся оценки энергии взаимодействия точечных дефектов с доменными стенками на основе экспериментальных зависимостей эффективной диэлектрической проницаемости и второй гармоники тока переполяризации от амплитуды переменного электрического поля для ряда кристаллов группы  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  и триглицинсульфата. Показано, что энергия взаимодействия стремится к нулю при приближении к температуре фазового перехода, а ее абсолютные значения находятся в пределах  $10^{-3}$ — $10^{-1}$  эВ.

Для изучения процессов переполяризации в сегнетоэлектрических кристаллах используют метод петель диэлектрического гистерезиса, методику Мерца и эффект Баркгаузена [1], реже применяют методы эффективной диэлектрической проницаемости  $\epsilon_{\text{эфф}}$  ( $\epsilon$ , измеренная в сильном переменном электрическом поле  $E_\sim$ ) и гармонического анализа тока переполяризации в синусоидальном поле  $E_\sim$  [2, 3].

В ряде случаев использование двух последних методик позволяет понять особенности процессов переключения, обусловленные наличием в сегнетоэлектрических кристаллах точечных дефектов естественного или искусственного происхождения [4—6], и оценить некоторые микропараметры кристаллов.

В настоящей работе сделана попытка оценить энергию взаимодействия точечных дефектов с доменными стенками  $U_{\text{вз}}$  на основе зависимостей  $\epsilon_{\text{эфф}}(E_\sim)$  и  $U_2(E_\sim)$  ( $U_2$  — амплитуда второй гармоники напряжения, снижаемого сопротивления, включенного последовательно с образцом).

В качестве объектов исследования использовались номинально чистые кристаллы  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  (KDP),  $\text{CsH}_2\text{PO}_4$  (CDP),  $\text{CsH}_2\text{AsO}_4$  (CDA), а также кристалл триглицинсульфат (ТГС) — номинально чистый и дефектный.

Образцы полярных срезов исследованных кристаллов, как правило, толщиной  $\sim 1$  мм имели электроды, нанесенные испарением серебра в вакууме. Методы исследования зависимостей  $\epsilon_{\text{эфф}}(E_\sim)$  и  $U_2(E_\sim)$  описаны в работах [2, 4, 6].

Расчет энергии взаимодействия точечных дефектов с доменными стенками был проведен с использованием модели [7], которая была предложена для объяснения механических потерь в сегнетоэлектриках.

Согласно модели [7], механические потери обусловлены процессом лавинообразного отрыва доменных стенок от закрепляющих их точечных дефектов. Основные положения модели и расчетные формулы могут быть использованы при анализе зависимостей  $\epsilon_{\text{эфф}}(E_\sim)$  и  $U_2(E_\sim)$ , поскольку эти зависимости обусловлены тем же механизмом, что и механические (или диэлектрические) потери, — взаимодействием в процессе переполяризации точечных дефектов со стенками.

Согласно [7], величина  $U_{ss}$  определяется из выражения, связывающего  $\epsilon_{\text{зф}}$  (или  $U_2$ ) с амплитудным значением поля  $E_{\sim}$

$$\epsilon_{\text{зф}} = \text{const} \exp(-g^2/E_{\sim}^2).$$

Здесь  $g = U_{ss}/P_s d^2 \delta$ , где  $P_s$  — спонтанная поляризация кристалла;  $d$  — расстояние между дефектами, от которых отрывается доменная стенка под действием переполяризующего поля;  $\delta$  — толщина доменной стенки.

Значения параметров  $d \sim 10^{-5}$  см и  $\delta \sim 10^{-7}$  см взяты из работ [8, 9], они не варьировались при переходе от кристалла к кристаллу.

Как видно из рис. 1, точки зависимостей  $\ln \epsilon_{\text{зф}}$  от  $1/E_{\sim}^2$  (как и  $\ln U_2$  от  $1/E_{\sim}^2$ ) хорошо ложатся на прямую, что является доказательством возможности применения модели [7] к нашим исследованиям и что позволяет рассчитать сначала коэффициент  $g$ , а затем и  $U_{ss}$ .

Энергия взаимодействия дефекта с доменной стенкой определяется силой, с которой дефект (стопор) закрепляет доменную стенку. Естественно

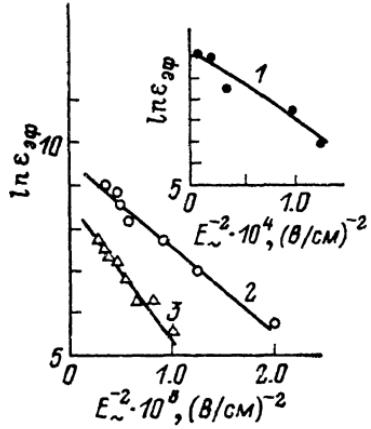


Рис. 1. Зависимость  $\ln \epsilon_{\text{зф}}$  от  $1/E_{\sim}^2$  для кристаллов ТГС: чистого (1) легированного хромом (2),  $L_{\alpha}$ -аланином (3).  $T \approx 23.0$  °C,  $f = 50$  Гц.

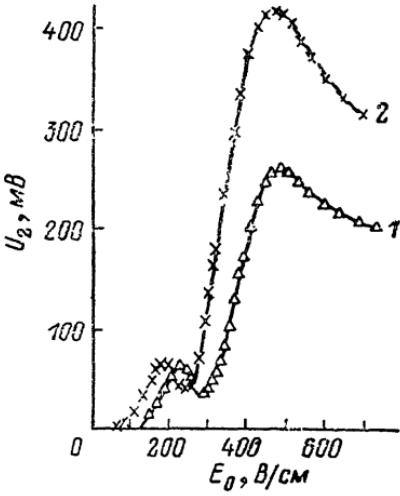


Рис. 2. Зависимости  $U_2$  от  $E_{\sim}$  для кристалла ТГС: с хромом (1), подвергнутого рентгеновскому облучению (2).  $T \approx 20$  °C,  $f = 500$  Гц.

предположить, что в кристалле существует некоторое распределение по энергиям взаимодействия. Если бы такого распределения не было, то значения  $\epsilon_{\text{зф}}$  (или  $U_2$ ) по достижению определенной величины поля  $E_{\sim}$  возрастали бы скачком до максимальной величины. Опыт показывает, что это не так (рис. 2—4). Поэтому экспериментально определяемой является величина  $U_{ss}$ , отвечающая максимуму функции распределения.

Вопрос о том, в какой области переменных электрических полей (слабых или сильных) справедлива модель [7], не решается однозначно; это зависит от температуры опыта, наличия в кристалле дефектов и пр. Если обратиться к рис. 2, то видно, что амплитудная зависимость напряжения второй гармоники имеет два максимума: первый в области слабых электрических полей, существование которого обусловлено неоднородным распределением дефектов в кристалле [6, 10], а второй соответствует максимальной переполяризации образца. Расчет энергии взаимодействия может быть проведен на восходящем участке как первого, так и второго максимума, т. е. в тех полях, где  $U_2$  (или  $\epsilon_{\text{зф}}$ ) является величиной амплитудно-зависимой, что свидетельствует о возникновении процесса отрыва доменных стенок от дефектов. Значения энергии взаимодействия, рассчитанные в области слабых и сильных электрических полей, отличаются примерно в 1.5 раза. Увеличение энергии  $U_{ss}$ , полученное в сильных электрических

полях, говорит о том, что в этих электрических полях в процесс переполяризации включаются доменные стенки, закрепленные «сильными» стопорами.

## Основные результаты и их обсуждение

Метод эффективной диэлектрической проницаемости. На рис. 3 представлены зависимости  $\epsilon_{\text{эфф}}(E_{\text{~}})$  для ряда кристаллов группы KDP. Здесь не приведена аналогичная зависимость

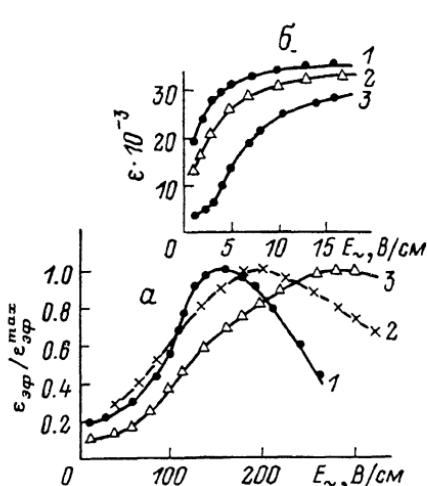


Рис. 3. Зависимости  $\epsilon_{\text{эфф}}$  от  $E_{\text{~}}$ :  
а — для кристаллов KDP (1), KDP (2), CDA (3),  $f=1$  кГц; б — для кристалла KDP.

а: 1 —  $\Delta T_c = 7.5$ , 2 — 6.6, 3 — 5.0; б: 1 — 6.6, 2 — 14.5, 3 — 24.8 К.

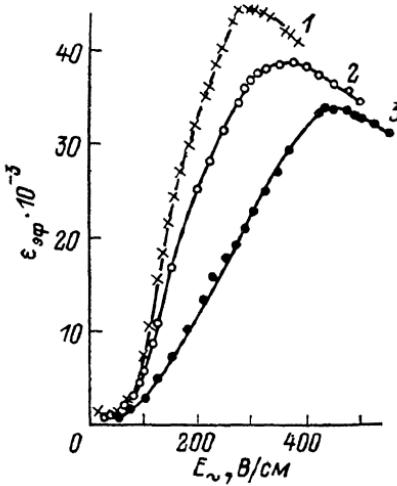


Рис. 4. Зависимости  $\epsilon_{\text{эфф}}$  от  $E_{\text{~}}$  для кристалла ТГС с примесью хрома, снятые при  $f=60$  (1), 120 (2), 240 Гц (3).  $T \approx 20$  °К.

для кристалла СДР (наиболее «мягкого» из всех кристаллов этой группы [11]), так как максимум этой кривой приходится на область полей  $\sim 10$  В/см при том же удалении от точки Кюри.

Из значений энергии взаимодействия (см. таблицу) следует, что самой подвижной доменной структурой обладает кристалл СДР, другие кристаллы располагаются за ним в той последовательности, которая была указана в [11].

По мере удаления от точки Кюри в сторону низких температур наблюдается возрастание энергии взаимодействия (рис. 3, б), эта закономерность прослеживается для всех кристаллов. Например, для кристалла KDP  $U_{\text{вз}}$  возрастает от  $0.48 \cdot 10^{-3}$  эВ при  $\Delta T_c = 6.6$  К до  $1.28 \cdot 10^{-3}$  эВ при  $\Delta T_c = 25$  К.

Зависимости  $\epsilon_{\text{эфф}}(E_{\text{~}})$  были получены и для кристалла ТГС —名义ально чистого, легированного хромом (рис. 4), L,  $\alpha$ -аланином и облученным рентгеновскими квантами. Если содержание примеси в кристалле невелико, то  $U_{\text{вз}}$  имеет значение сотых долей эВ (рис. 5); внутреннее поле  $E_{\text{вн}}$  в этом случае равно  $\sim 50$  В/см. С увеличением концентрации дефектов (примесных или радиационных)  $U_{\text{вз}}$  возрастает до десятых долей эВ. В этом случае внутреннее поле может быть равно сотням В/см.

Метод гармонического анализа. Появление четных гармоник в спектре тока переполяризации сегнетоэлектриков является признаком униполярности кристалла, существования поля  $E_{\text{вн}}$  [6]. Выше-

Кристалл	$\Delta T_c$ , К	$U_{\text{вз}} \cdot 10^3$ , эВ
CDP	7.5	0.10
KDP	6.6	0.48
CDA	5.0	15.90

было сказано, что если дефекты в объеме кристалла распределены неравномерно и образец не подвергался температурному или полевому отжигам, то в зависимости четных и нечетных гармоник (кроме первой) может наблюдаться несколько максимумов, свидетельствующих, что процесс переполяризации осуществляется в больших областях образца кристалла, которым отвечают свои значения коэрцитивных полей [6, 10].

На рис. 5 представлены температурные зависимости  $U_{\text{вз}}$  для образца кристалла с хромом; хорошо видно, что абсолютные значения  $U_{\text{вз}}$ , рассчитанные из зависимостей  $\epsilon_{\text{аф}}(E_{\sim})$  и  $U_2(E_{\sim})$ , практически совпадают.

Стремление энергии взаимодействия к нулю при приближении к температуре фазового перехода  $T_c$  понятно, так как при  $T \rightarrow T_c$  толщина доменной стенки возрастает (теоретически стремится к бесконечности [12]),

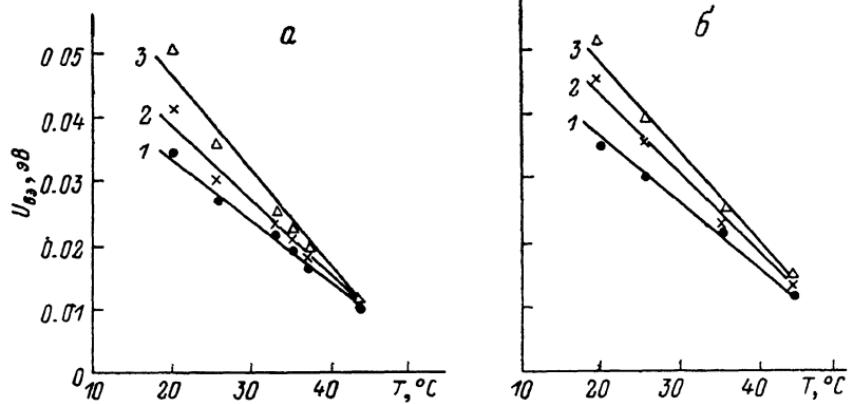


Рис. 5. Температурная зависимость энергии взаимодействия  $U_{\text{вз}}$  при нескольких частотах электрического поля (1 — 60, 2 — 240, 3 — 500 Гц), полученная из зависимостей  $U_2(E_{\sim})$  (а) и  $\epsilon_{\text{аф}}(E_{\sim})$  (б) на одном и том же образце кристалла ТГС с хромом.

одновременно увеличивается и интенсивность теплового движения ионов кристаллической решетки кристалла и дефектов. Этот экспериментальный результат, полученный в настоящей работе, находится в соответствии с теоретическими оценками [13].

Что касается полученной нами зависимости энергии взаимодействия от частоты электрического поля, то можно предположить, что величиной определяемой из зависимостей  $\epsilon_{\text{аф}}(E_{\sim})$ ,  $U_2(E_{\sim})$ , является эффективная энергия взаимодействия (назовем ее так)  $U_{\text{вз}}^* = U_{\text{вз}} + U_0$ , где  $U_0$  — величина энергии, пропорциональная внешнему воздействию, например полевому, оказываемому на кристалл в процессе снятия экспериментальных кривых [14].

Сама величина  $U_0$  в свою очередь может быть функцией других параметров, например частоты электрического поля, т. е. времени его действия (что может явиться задачей отдельного изучения).

Несмотря на некоторую неопределенность оценки  $U_{\text{вз}}$ , указанную выше, экспериментальные методы ее определения имеют право на существование, поскольку дают возможность сравнивать эту величину для разных кристаллов, особенно при одних и тех же условиях эксперимента.

Авторы благодарят С. А. Гриднева за обсуждение результатов работы.

#### Список литературы

- [1] Рудяк В. М. Процессы переключения в нелинейных кристаллах. М., 1986. 248 с.
- [2] Камышева Л. Н., Годованная О. А., Миловидова С. Д., Коваленко А. Н. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1975. Т. 39. № 4. С. 857—860.
- [3] Карпов А. И., Поплавко Ю. М. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1984. Т. 48. № 6. С. 1193—1196.
- [4] Камышева Л. Н., Годованная О. А., Миловидова С. Д., Коваленко А. Н. // Кристаллография. 1974. Т. 19. № 4. С. 824—827.

- [5] Камышева Л. Н., Дрождин С. Н., Сердюк О. М. // Деп. в ВИНИТИ. 1988. № 3042-В 88. 42 с.
- [6] Drozhdin S. N., Kamysheva L. N., Liberman Z. A. // Phys. St. Sol. (a). 1986. V. 94. P. K69—K73.
- [7] Гридинев С. А., Даринский Б. М., Постников В. С. // Механизмы релаксационных явлений в твердых телах. М., 1972. С. 206—211.
- [8] Сидоркин А. С., Даринский Б. М., Панкова Т. Н. // Изв. АН СССР, сер. физ. 1984. Т. 48. № 6. С. 1135—1142.
- [9] Леванюк А. П., Осипов В. В., Сигов А. С., Собянин А. А. // ЖЭТФ. 1979. Т. 76. № 3. С. 345—368.
- [10] Карпов А. И. // Тез. докл. XII Всес. конф. по физике сегнетоэлектриков. Ростов н/Д, 1989. Т. 3. С. 8.
- [11] Гридинев С. А., Камышева Л. Н., Сидоркин А. С. Сегнетоэлектрические кристаллы группы  $\text{KH}_2\text{PO}_4$ . Воронеж, 1981. 116 с.
- [12] Струков Б. А., Леванюк А. П. Физические основы сегнетоэлектрических явлений в кристаллах. М., 1983. 239 с.
- [13] Нечаев В. Н. // Автореф. канд. дис. Воронеж, 1980.
- [14] Камышева Л. Н., Сердюк О. М., Зайцева О. А. // Тез. докл. XII Всес. конф. по физике сегнетоэлектриков. Ростов н/Д, 1989. Т. 3. С. 7.

Воронежский государственный университет  
им. Ленинского комсомола

Поступило в Редакцию

20 июля 1989 г.

В окончательной редакции  
26 октября 1989 г.